

01;05;10

## Эффективный потенциал плоскостного каналирования в кристалле LiH

© Н.А. Корхмазян, Н.Н. Корхмазян, Н.Э. Бабаджанян

Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна,  
375010 Ереван, Армения  
e-mail: norayrk@web.am

(Поступило в Редакцию 15 июля 2002 г.)

Рассмотрена задача об определении эффективных потенциалов каналирования вдоль заряженных плоскостей (111) и  $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$  в конечном кристалле LiH. Получены критерии применимости формул в случае бесконечного кристалла. Дана оценка величины поверхностного слоя кристалла, где эти формулы не применимы.

### Введение

Как известно, релятивистская заряженная частица при каналировании вдоль кристаллографических плоскостей (осей) кристалла совершает поперечные колебания, что сопровождается излучением [1–3]. В определенных условиях генерируется лазероподобное гамма-излучение, которое по своим характеристикам находится вне конкуренции по сравнению с другими видами излучения в указанном диапазоне частот [4]. Такие пучки жестких квантов имеют множество прикладных применений, что делает актуальным исследование более широкого класса кристаллических радиаторов. Особый интерес представляет нахождение эффективных потенциалов каналирования в легких ионных кристаллах типа LiH вдоль заряженных плоскостей с коэффициентами Миллера (111) и  $(\bar{1}\bar{1}\bar{1})$ , поскольку длина деканалирования в этом случае более чем на порядок больше, чем соответствующая величина при каналировании вдоль других плоскостей [5]. Большой вклад в исследование потенциалов каналирования в ионных кристаллах был сделан группой авторов в работах [6–9], где развит общий метод расчета потенциалов, учитывающий вклад в потенциал от всех ионов кристалла. Однако полученные в результате выражения оказываются достаточно сложными, что несколько ограничивает возможность их аналитического исследования. В недавно вышедшей экспериментальной работе [10], где исследуется излучение электронов и позитронов при каналировании вдоль главных кристаллографических плоскостей в кристаллах LiH и LiD, отмечается, что используемый авторами потенциал свободного иона не приводит к согласию с экспериментом и нуждается в пересмотре. Таким образом, необходимость нахождения корректного выражения для потенциала каналирования в легких кристаллах конечных размеров становится очевидной. В работе [5] эта задача решена для бесконечного кристалла.

В настоящей работе та же задача решена для кристаллов, имеющих конечные размеры.

### Эффективный потенциал кристалла в случае бесконечных плоскостей

Для расчета эффективного потенциала воспользуемся методом эквивалентных ячеек, впервые изложенным в [9]. Суть метода заключается в том, что ионы (центры ионов в „замороженном“ кристалле), находящиеся на плоскостях, параллельных плоскостям каналирования, перераспределяются таким образом, чтобы упростить геометрию задачи. При этом элементарная ячейка усреднения приводится к желаемой форме, оставляя площадь ячейки неизменной.

Кристаллы LiH и LiD относятся к классу гранецентрированных кристаллов и имеют структуру, приведенную на рис. 1, *a*. Выберем оси координат так, как показано на рис. 1, *b*. Расстояние между ближайшими одноименными ионами вдоль осей  $x'$  и  $y'$  (постоянная решетки кристалла) равно  $d = 4.084 \text{ \AA}$ . Плоскость (HNN) получается вращением плоскости  $(x', y')$  сначала вокруг оси  $z'$  на угол  $\varphi = \pi/4$ , а затем вокруг новой оси  $x$  на угол  $\alpha$ , где  $\text{tg } \alpha = \sqrt{2}$ . Для расстояния между одноименными

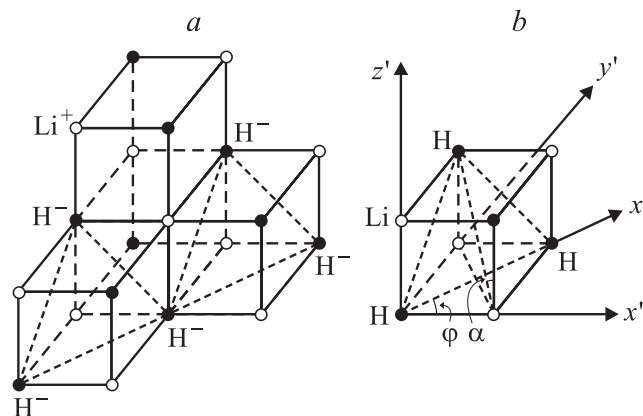


Рис. 1. *a* — структура кристалла LiH. (HNN) — заряженная плоскость, *b* — выбор осей координат.

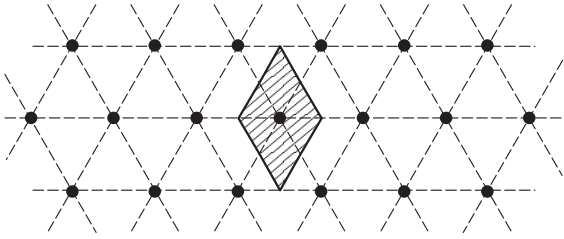


Рис. 2. Распределение ионов одного знака на плоскости  $(1\bar{1}1)$ . Выбор ячейки усреднения.

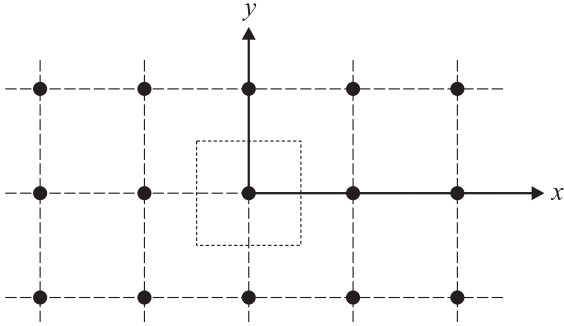


Рис. 3. Выбор эквивалентных ячеек.

и разноименными плоскостями соответственно имеем

$$d_z = d/\sqrt{3} = 2.358 \text{ \AA}, \quad d_z/2 = 1.179 \text{ \AA}. \quad (1)$$

Распределение ионов на заряженной плоскости  $(1\bar{1}1)$  имеет вид, приведенный на рис. 2. В качестве ячейки усреднения выберем заштрихованный ромб с площадью  $\sqrt{3}d^2/4$ . Для эквивалентной квадратной ячейки  $(d_0 \times d_0)$  находим

$$d_0 = 3^{1/4}d/2 = 2.6874 \text{ \AA}. \quad (2)$$

Таким образом, распределение ионов на плоскости  $(x, y)$  окончательно приводится к виду, представленному на рис. 3. Ось  $z$  направлена перпендикулярно плоскости рисунка. Квадратная ячейка усреднения лежит на плоскости  $z = \text{const}$  (рис. 4). Центр ячейки находится

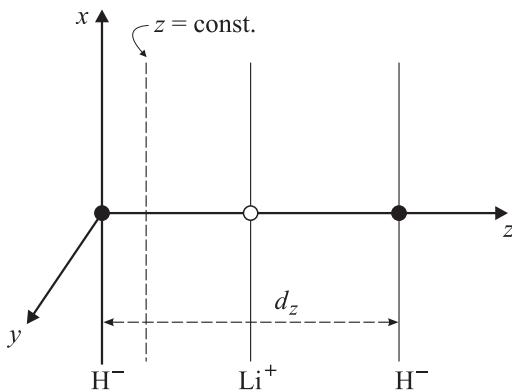


Рис. 4. Выбранный канал и плоскость  $z = \text{const}$ , на которой определяется усредненный потенциал.

на оси  $z$ . В точке  $(0, 0, 0)$  находится ион водорода ( $H^-$ ), а в точке  $(0, 0, d_z/2)$  — ион лития ( $Li^+$ ). Назовем эти два иона базисными ионами. Как известно [9], эффективные радиусы этих ионов равны соответственно

$$R(H^-) = 1.50 \text{ \AA}, \quad R(Li^+) = 0.68 \text{ \AA}. \quad (3)$$

Эффективный потенциал плоскостного каналирования достаточно вычислить в полуканале

$$0 \leq z \leq d_z/2, \quad (4)$$

поскольку плоскость  $z = d_z/2$  является плоскостью симметрии канала. Смысл радиусов (3) состоит в том, что на этих расстояниях от ядер ионов плотность электронного облака можно считать равной нулю. Из (3) и (4) следует, что, кроме базисного положительного иона, все остальные положительные ионы можно считать точечными. Аналогичное утверждение можно сделать и для отрицательных ионов, несмотря на то что для них  $R(H^-) > d_z/2$ . В самом деле, как известно [11], плотность электронного облака в двухэлектронном ионе (атоме) в зависимости от расстояния до ядра  $r$  определяется формулой

$$\rho(r) = -\frac{e\lambda^3}{4\pi} e^{-\lambda r}, \quad \lambda = \frac{2z^*}{a_0}, \quad z^* = z - 5/16, \quad (5)$$

где  $a_0 = 0.528 \text{ \AA}$  — радиус Бора,  $z$  — число протонов в ядре,  $-e$  — заряд электрона.

Согласно (3), для иона  $H^-$  можно считать  $\rho(1.5 \text{ \AA}) = 0$ . Оценим значение  $\rho$  на расстоянии  $r = d_z/2 = 1.179 \text{ \AA}$ .

Согласно (5), имеем

$$\begin{aligned} & [\rho(1.179 \text{ \AA}) - \rho(1.5 \text{ \AA})] / \rho(1.5 \text{ \AA}) \\ &= \exp(2z^*(1.5 - 1.179)/0.53) - 1 \cong 1.3, \quad z^- = 1. \end{aligned}$$

Отсюда находим  $\rho(1.179 \text{ \AA}) \cong 2.3\rho(1.5 \text{ \AA})$ , что с большей точностью можно считать равным нулю.

В „сконструированном“ нами кристалле отрицательные ионы находятся в узлах  $L = (ld_0, md_0, nd_z)$ , где  $l, m, n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ . Положительная подрешетка смещена относительно отрицательной на вектор  $\alpha = (0, 0, d_z/2)$ . Потенциал, создаваемый отрицательной подрешеткой в точке  $r = (x, y, z)$ , определяется формулой

$$\varphi_{\text{tot}}^- = \frac{ez^-}{|r|} + \varphi_{el}^- - e \sum_{L \neq 0} \frac{1}{|r - L|}, \quad (6)$$

где первое слагаемое — поле ядра базисного иона, второе слагаемое — поле электронного облака этого иона, а третье слагаемое — поле всех остальных отрицательных точечных ионов.

Для расчета функции  $\varphi_{el}^-$  воспользуемся теоремой Гаусса, а также распределением (5). Тогда для проекции

напряженности электрического поля на вектор  $\mathbf{r}$  имеем

$$E_r = \frac{q(r)}{r^2},$$

$$q(r) = -\frac{2e}{\pi} \left( \frac{z^-}{a_0} \right)^3 4\pi \int_0^r \exp(-2z^- \xi/a_0) \xi^2 d\xi,$$

$$r = |\mathbf{r}|. \quad (7)$$

Воспользовавшись формулой

$$\varphi_\infty - \varphi(r) = -\int_r^\infty E_r dr, \quad \varphi_\infty = 0,$$

находим

$$\varphi_{el}^-(r) = e\lambda^- e^{-\lambda^- r} + \frac{2e}{r} e^{-\lambda^- r} - \frac{2e}{r}. \quad (8)$$

Подставляя это выражение в (6), получим

$$\varphi_{\text{tot}}^- = e\bar{\lambda} e^{-\bar{\lambda} r} + \frac{2e}{r} e^{-\bar{\lambda} r} - e \sum_{l,m,n} \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{L}|}, \quad (9)$$

где сумма включает также и вклад от узла  $\mathbf{L} = 0$ .

Проведем усреднение полученного потенциала по элементарной ячейке кристалла

$$\langle \varphi_{\text{tot}}^- \rangle = \frac{1}{d_0^2} \int_{-d_0/2}^{d_0/2} dx \int_{-d_0/2}^{d_0/2} \varphi_{\text{tot}}^- dy. \quad (10)$$

При вычислении средних от первых двух слагаемых в (9) целесообразно перейти к цилиндрическим координатам и проводить интегрирование по кругу с радиусом  $R_0 = d_0/\sqrt{\pi}$

$$\langle \varphi_{1,2}^- \rangle = \frac{2\pi}{d_0^2} \int_0^{R_0} \varphi_{1,2}^- \rho d\rho, \quad r = \sqrt{\rho^2 + z^2}. \quad (11)$$

Тогда вместо (10) имеем

$$\langle \varphi_{\text{tot}}^- \rangle = \frac{2\pi e}{d_0} (f_1^- + f_2^-) - e \left\langle \sum_{l,m,n} \dots \right\rangle,$$

$$f_1^- = \frac{1}{\lambda^- d_0} \left[ (\lambda^- |z| + 1) e^{-\lambda^- |z|} - (\lambda^- \sqrt{R_0^2 + z^2} + 1) e^{-\lambda^- \sqrt{R_0^2 + z^2}} \right];$$

$$f_2^- = \frac{2}{\lambda^- d_0} \left[ e^{-\lambda^- |z|} - e^{-\lambda^- \sqrt{R_0^2 + z^2}} \right], \quad (12)$$

где в  $f_1^-$  и  $f_2^-$  все отрезки выражены в единицах  $d_z$ .

Поэтому теперь область изменения  $z$  определяется выражением  $0 \leq z \leq 1/2$ . Потенциал положительной подрешетки получится из (12) заменой  $\bar{\lambda} \Rightarrow \lambda^+$

и  $z \Rightarrow -(1/2 - z)$ . Вычислим среднее от суммы в выражении (12). Необходимо отметить, что эта сумма от бесконечного числа отрицательно заряженных плоскостей кристалла обращается в бесконечность и конечный результат получается лишь при совместном учете вкладов от отрицательно и положительно заряженных плоскостей. Обозначим последнее слагаемое в выражении (12) через  $I^-$ . Тогда имеем

$$I^- = -\frac{e}{d_0^2} \sum_{l,m,n} \int_{-d_0/2}^{d_0/2} dx$$

$$\times \int_{-d_0/2}^{d_0/2} \frac{dy}{\sqrt{(x - ld_0)^2 + (y - md_0)^2 + (z - nd_0)^2}}$$

$$= -\frac{e}{d_0} \sum_{l,m,n} \int_{-1/2}^{1/2} dx \int_{-1/2}^{1/2} \frac{dy}{\sqrt{(x-l)^2 + (y-m)^2 + p^2(z-n)^2}}, \quad (13)$$

где  $x$  и  $y$  выражены в единицах  $d_0$ ,  $z$  — в единицах  $d_z$ , а  $p = d_z/d_0 = 0.8774$ .

Вводя обозначение  $p^2(n-z)^2 = a^2$  и просуммировав выражение (13) по  $m$ , получим

$$\sum_{l,m,n} \dots = 2 \sum_{l,n} \int_{-1/2}^{1/2} dx \left[ \int_0^{1/2} \frac{dy}{\sqrt{(x-l)^2 + y^2 + a^2}} + \int_{1/2}^{3/2} \frac{dy}{\sqrt{(x-l)^2 + y^2 + a^2}} + \dots \right]$$

$$= 2 \sum_{l,n} \int_{-1/2}^{1/2} dx \int_0^\infty \frac{dy}{\sqrt{(x-l)^2 + y^2 + a^2}}$$

$$= 2 \sum_{l,n} \int_{-1/2}^{1/2} dx \ln \left| \frac{y}{\sqrt{(l-x)^2 + a^2}} + \sqrt{1 + \frac{y^2}{(l-x)^2 + a^2}} \right|_0^\infty. \quad (14)$$

Объединяя это выражение с соответствующей суммой от положительной подрешетки и вводя обозначение  $p^2(n+1/2-z)^2 = b^2$ , находим

$$I = I^- + I^+$$

$$= \frac{e}{d_0} \sum_n \left[ \sum_l \int_{-1/2}^{1/2} \ln \frac{(l-x)^2 + a^2}{(l-x)^2 + b^2} dx \right]. \quad (15)$$

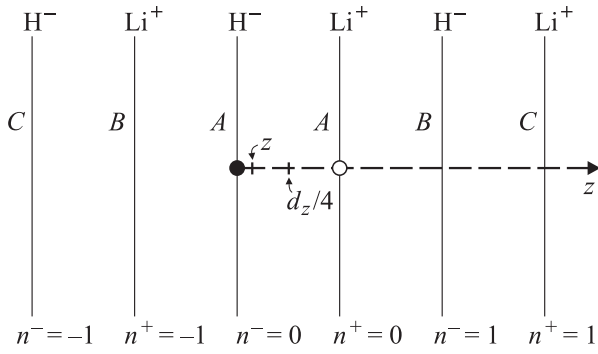


Рис. 5. Заряженные плоскости бесконечного кристалла.

Просуммировав аналогичным образом по  $l$ , получим

$$I = \frac{2\pi e}{d_0} p \left[ \sum_{n^-} |n^- - z| - \sum_{n^+} |n^+ + 1/2 - z| \right], \quad (16)$$

где  $n^-$  и  $n^+$  относятся соответственно к отрицательной и положительной подрешеткам кристалла (рис. 5).

Сложив вклады от соответствующих пар (AA), (BB), ... плоскостей, получим

$$I = \frac{2\pi e}{d_0} p [(2z - 1/2) - (2z - 1/2) + (2z - 1/2) - \dots]. \quad (17)$$

Нетрудно заметить, что полученный потенциал не имеет определенного значения. Как будет показано ниже, это связано с тем, что размеры кристалла вдоль пролета частицы во много раз превосходят поперечные размеры кристалла.

## Эффективный потенциал конечного кристалла

Соответствующий выражению (17) ряд будет сходящимся, если принять, что кристалл имеет конечные размеры  $L$  вдоль пролета каналированной частицы в плоскости  $(x, y)$ . Совместим ось  $x$  с направлением движения частицы. Пусть, кроме того, элементарная ячейка находится на расстоянии  $l_1$  (в единицах  $d_0$ ) от одной грани кристалла и на расстоянии  $l_2$  от второй грани, где для определенности будем считать  $l_1 \leq l_2$ . Обычно толщина кристалла бывает порядка  $L \approx 10^7 \text{ \AA}$ , а длина деканалирования колеблется в пределах  $10^4 - 10^5 \text{ \AA}$ . Поэтому всегда можно исключить из рассмотрения некий тонкий поверхностный слой кристалла толщиной порядка  $100 \text{ \AA}$ . Другими словами, можно ограничиться условием  $l_1 \gg 1$ . Это допущение вполне правомерно, поскольку толщина этого слоя более чем на два порядка меньше длины деканалирования. В формуле (15) проведем суммирование

по  $l$  в пределах  $-l_2 \leq l \leq l_1$ . Тогда получим

$$I = I(l_1) + I(l_2) = \frac{e}{d_0} \sum_n \left[ \int_0^{l_1+1/2} \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2 + b^2} dx + \int_0^{l_2+1/2} \ln \frac{x^2 + a^2}{x^2 + b^2} dx \right]. \quad (18)$$

Отсюда имеем

$$I(l_{1,2}) = \frac{e}{d_0} \sum_{n^-=-N}^N \left[ (l_{1,2} + 1/2) \ln [(l_{1,2} + 1/2)^2 + a^2] + 2a \operatorname{arctg} \frac{l_{1,2} + 1/2}{a} \right] - \frac{e}{d_0} \sum_{n^+=-N}^N \left[ (l_{1,2} + 1/2) \times \ln [(l_{1,2} + 1/2)^2 + b^2] + 2b \operatorname{arctg} \frac{l_{1,2} + 1/2}{b} \right]. \quad (19)$$

Вводя обозначение  $(l_{1,2} + 1/2)/p \equiv A_{1,2}$ , находим

$$I(l_1) = \frac{e}{d_0} P \sum_{n^-=-N}^N \left[ A_1 \ln [A_1^2 + (n^- - z)^2] + 2(n^- - z) \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n^- - z} \right] - \frac{e}{d_0} P \times \sum_{n^+=-N}^N \left[ A_1 \ln [A_1^2 + (n^+ - z + 1/2)^2] + 2(n^+ - z + 1/2) \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n^+ - z + 1/2} \right]. \quad (20)$$

Ввиду того что  $A_1 \gg 1$ , логарифмические функции являются медленно меняющимися функциями аргументов  $n^\pm$ . Поэтому для этих функций суммы можно заменить интегралами

$$\sum_{n^-=-N}^N A_1 \ln [A_1^2 + (n^- - z)^2] \Rightarrow \Rightarrow A_1 \int_{-N}^N \ln [A_1^2 + (n^- - z)^2] dn^-. \quad (21)$$

Нетрудно убедиться, что в предельных случаях  $N \gg A_1$  и  $N \ll A_1$  для интегралов от логарифмических функций соответственно имеем

$$\frac{5}{2} \frac{A_1}{N} \ll 1, \quad 3 \frac{N}{A_1} \ll 1. \quad (22)$$

Тогда вместо (20) имеем

$$I(l_1) = \frac{2e}{d_0} P \left[ \sum_{n^-=-N}^N (n^- - z) \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n^- - z} - \sum_{n^+=-N}^N (n^+ - z + 1/2) \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n^+ - z + 1/2} \right]. \quad (23)$$

Это выражение в случае  $A_1 \gg N$  приводится к виду

$$I(l_1) = \frac{\pi e}{d_0} P \left( \sum_{n^-=-N}^N |n^- - z| - \sum_{n^+=-N}^N |n^+ - z + 1/2| \right) \quad (24)$$

и с учетом того, что  $I(l_2) = I(l_1)$ , мы приходим окончательно к формуле (17). Таким образом, если размеры кристалла вдоль оси  $z$  много меньше, чем вдоль пролета частицы ( $N \ll A_1$ ), то потенциал конечного кристалла ведет себя внутри кристалла таким же образом, как потенциал бесконечного кристалла.

В обратном случае ( $N \gg A_1$ ) функции под суммами в выражении (23) не являются медленно меняющимися функциями своих аргументов, поэтому для расчета потенциала необходимо найти сначала напряженность поля

$$E_z = -\frac{1}{d_z} \frac{dI}{dz}. \quad (25)$$

Продифференцируем выражение (23) по  $z$

$$\begin{aligned} \frac{dI(l_1)}{dz} = & -\frac{2e}{d_0} P \left[ \sum_{n=-N}^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z} - \sum_{n=-N}^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z+1/2} \right] \\ & + \frac{2e}{d_0} P \left[ \sum_{n=-N}^N (n-z) \frac{d}{dz} \left( \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z} \right) - \sum_{n=-N}^N (n-z+1/2) \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z+1/2} \right]. \quad (26) \end{aligned}$$

Второе слагаемое в этом выражении дает малую величину

$$P \frac{2e}{d_0} \frac{A_1}{N}. \quad (27)$$

Поэтому вместо (26) можем написать

$$\begin{aligned} \frac{dI(l_1)}{dz} = & -\frac{2e}{d_0} P \left[ \sum_{n=-N}^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z} - \sum_{n=-N}^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z+1/2} \right]. \quad (28) \end{aligned}$$

Если в этом выражении выделить слагаемые с  $n=0$ , то под суммами останутся медленно меняющиеся функ-

ции, поэтому вместо (28) получим

$$\begin{aligned} \frac{dL(l_1)}{dz} = & \frac{2\pi e}{d_0} P + \frac{2e}{d_0} P \left[ \int_1^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n+z} dn - \int_1^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-z} dn + \int_1^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n+(1/2-z)} dn - \int_1^N \operatorname{arctg} \frac{A_1}{n-(1/2-z)} dn \right]. \quad (29) \end{aligned}$$

Используя формулы

$$\operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}; \quad x > 0,$$

$$\int \operatorname{arctg} \frac{x}{A} = x \operatorname{arctg} \frac{x}{A} + \frac{A}{2} \ln(A^2 + x^2), \quad (30)$$

получим

$$\frac{dL(l_1)}{dz} = \frac{2\pi e}{d_0} P - \frac{\pi e}{d_0} P = \frac{\pi e}{d_0} P. \quad (31)$$

Окончательно, учитывая вклад также от слагаемого  $dI(l_2)/dz$ , для напряженности поля получим

$$E_z = -\frac{1}{d_z} \frac{2\pi e}{d_0} P. \quad (32)$$

Отсюда с учетом того, что  $I(1/4) = 0$ , находим потенциал точечной решетки, который приводится также в работе [5],

$$I(z) = \frac{2\pi e}{d_0} P(z - 1/4). \quad (33)$$

Согласно (12), для потенциала плоскостного каналирования окончательно имеем

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{\text{tot}} \rangle = & \langle \varphi_{\text{tot}}^+ \rangle + \langle \varphi_{\text{tot}}^- \rangle \\ = & \frac{2\pi e}{d_0} [f_1^+ + f_2^+ + f_1^- + f_2^- + P(z - 1/4)] \quad (34) \end{aligned}$$

или, пользуясь обозначениями (12),

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{\text{tot}} \rangle = & \frac{2\pi e}{d_0} f, \quad f = f^+ + f^- + P(z - 1/4), \\ f^- = & \frac{1}{\lambda d_0} \left[ (3 + \lambda^- z) e^{-\lambda^- z} - (3 + \lambda^- \sqrt{R_0^2 + z^2}) e^{-\lambda^- \sqrt{R_0^2 + z^2}} \right], \quad (35) \end{aligned}$$

а  $f^+$  получается заменой  $\lambda^- \Rightarrow \lambda^+$ ,  $z \Rightarrow 1/2 - z$ .

В заключение хотелось бы отметить, что изучение потенциала в поверхностном слое кристалла требует отдельного рассмотрения.

## Список литературы

- [1] *Кумахов М.А.* Излучение каналированных частиц в кристаллах. М.: Энергоатомиздат, 1986.
- [2] *Барышевский В.Г.* Каналирование, излучение и реакции при высоких энергиях. Минск: Изд-во БГУ, 1982.
- [3] *Базылев В.А., Жеваго Н.К.* Излучение быстрых частиц в веществе и во внешних полях. М.: Наука, 1987.
- [4] *Геворкян Л.А., Корхмазян Н.А.* // ДАН СССР. 1983. Т. 273. № 4. С. 849.
- [5] *Высоцкий В.И., Кузьмин Р.Н., Моксюта Н.В.* // ЖЭТФ. 1987. Т. 93. Вып. 6 (12). С. 2015.
- [6] *Геворкян А.С., Корхмазян Н.Н., Меликян Г.Г.* // ЖТФ. 1989. Т. 59. Вып. 3. С. 54. Препринт Ереванского физ. ин-та № ЕФИ-1051 (14)-88. 1988.
- [7] *Геворкян А.С., Корхмазян Н.Н., Меликян Г.Г.* Тез. докл. 15-го Всесоюз. совещания по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами. М., 1988. С. 32.
- [8] *Корхмазян Н.Н., Меликян Г.Г.* // Изв. НАН Армении. Физика. 1993. Т. 28. Вып. 2–3. С. 56.
- [9] *Корхмазян Н.А.* // Изв. НАН Армении. Физика. 1955. Т. 32. Вып. 5. С. 198.
- [10] *Berman B.L. et al.* // Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res. B. 1996. Vol. 119. P. 71.
- [11] *Бете Г., Солттер Э.* Квантовая механика с одним и двумя электронами. М.: Физматгиз, 1960.